

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成20年2月28日(2008.2.28)

【公表番号】特表2003-523364(P2003-523364A)

【公表日】平成15年8月5日(2003.8.5)

【出願番号】特願2001-561027(P2001-561027)

【国際特許分類】

C 07 K	5/09	(2006.01)
B 01 J	31/24	(2006.01)
C 07 C	255/60	(2006.01)
C 07 C	257/18	(2006.01)
C 07 K	1/02	(2006.01)
C 07 K	5/065	(2006.01)
C 07 K	5/068	(2006.01)
A 61 K	38/00	(2006.01)
A 61 P	7/02	(2006.01)
C 07 B	53/00	(2006.01)
C 07 B	61/00	(2006.01)

【F I】

C 07 K	5/09	
B 01 J	31/24	Z
C 07 C	255/60	
C 07 C	257/18	
C 07 K	1/02	
C 07 K	5/065	
C 07 K	5/068	
A 61 K	37/02	
A 61 P	7/02	
C 07 B	53/00	B
C 07 B	61/00	3 0 0
C 07 M	7:00	

【手続補正書】

【提出日】平成20年1月10日(2008.1.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0064

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0064】

上記の手順を使用して、4回のさらに別の不斉水素化を実施した[バッチサイズ8.0kg(25.97モル)-10.3kg(33.44モル)；水素圧2-10バール；温度40；水素化時間4~6時間；生成物含量98.0~99.8%(HPLC)；水素化溶液中の粗生成物のエナンチオマー純度62.0~84.5%eeのS異性体(GC)]。